



Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik / Zentrum für mikrotechnische Produktion

ULTRASCHALLMIKROSKOPIE Gerät & Prinzipien

Luise Geppert / Leopold Panier

Stand 02/2024





Gerätetechnik am IAVT / ZmP / nanoeva für die Ultraschallanalyse: Ultraschallmikroskop Sonoscan GEN6™ C-SAM®

Hersteller: Nordson Test & Inspection

Verwendungszweck:

Zerstörungsfreies Inspektionsverfahren für Zuverlässigkeitsuntersuchungen, zur Klärung von Ausfallmechanismen sowie zur Erfassung von Fehlerfortschreitungen nach Belastung

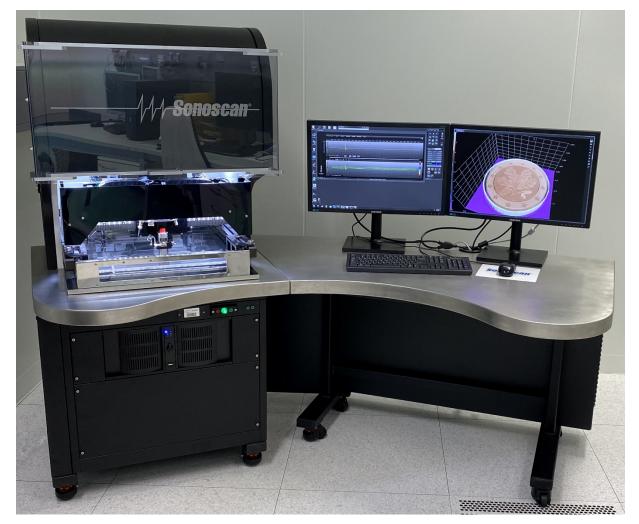
Typische Untersuchungsobjekte:

- IC im Plastikgehäuse, BGA, COB, CSP, Flip-Chip auf Gehäuserisse, Chipbrüche und Fehler in der Chipkontaktierung
- Keramik-Schaltungsträger (DCB), Leistungsmodule mit Kühlplatten
- Wafer und großflächige Verklebungen (z.B. Leiterplatten mit Heatsinks)
- sämtliche Schichtaufbauten aus in sich homogenen Materialien
- Prüfung von Wafern und Tafeln (bis Ø 310 mm und 10 mm Dicke) auf Defekte, Porigkeit,
 Verunreinigungen, Delaminationen sowie Materialinhomogenitäten mittels Laufzeitanalysen





Anlage Sonoscan GEN6





Übersicht Transducer





Wichtige Parameter / Eigenschaften:

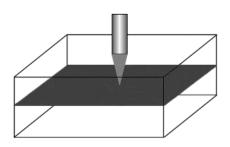
- Scanbereiche 1*1 308*308 mm²; max. 16.000 x 16.000 Pixel
- High Speed Scanner (Linearmotor) max. 600 mm/s; Positioniergenauigkeit ±0,5 μm
- Dual-Pulser/Receiver für Transducer von 5 400 MHz, Abtastrate max. 2 GHz
- Typische Eindringtiefe ist frequenz- und materialabhängig (0,1...10 mm)
- Laterale und axiale Auflösung ist frequenz- und materialabhängig ab 10 μm (gasgefüllte Delaminationen axial ab 30 nm detektierbar)
- Transducer: 10 MHz 230 MHz
- Ausgabe-Datenformate: Bilddateien; swdx-Datei vom C-Scan / Thru-Scan; csv- Datei vom A-Scan
- Voraussetzungen Probenanalyse: Planarität der Oberfläche, keine gas- oder luftgefüllten Hohlräume (bedingt bis gar nicht darstellbar)
- WICHTIG!
 Koppelmedium: entionisiertes Wasser die Proben liegen w\u00e4hrend der Analyse im DI-Wasserbad!

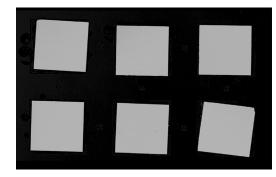


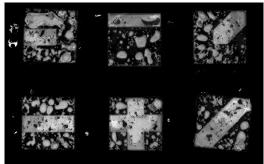


Untersuchungsverfahren:

• C-Scan (Impuls-Echo-Verfahren)



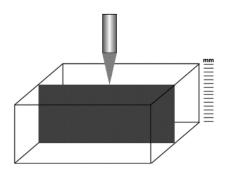




Oberflächenbild

Anbindung Lotschicht

• Q-BAM™ (hochauflösender Querschnitts-Scan)



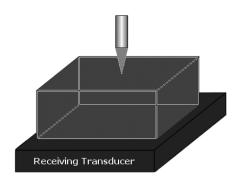


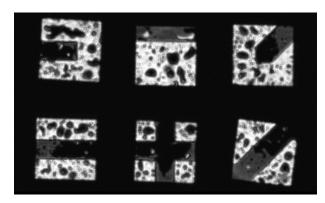
Übersichts- und Querschnittsbild



Untersuchungsverfahren:

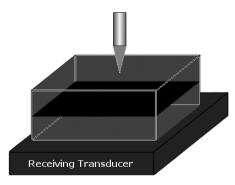
• THRU-Scan™ (Durchschallungs-Verfahren)





Durchschallung (dunkle Stellen –Delaminationen)

• STAR™ - Verfahren (Kombination von C- und Thru-Scan™)



Untersuchungsverfahren:

• VRM™ - Virtual Re-Scanning Module (komplette Speicherung der Echosignale des Probenvolumens) Regenerierung von Fehlerbildern beliebiger Ebenen, Gewinnung dreidimensionaler Informationen, Laufzeitanalyse für Materialuntersuchungen (Laufzeitdifferenzen unter 0,1 ns detektierbar)





Funktionsweise:

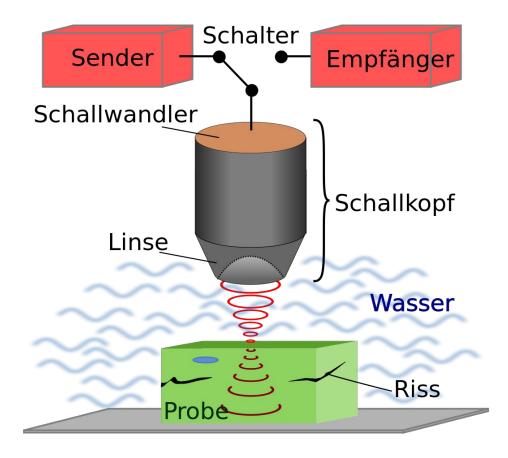


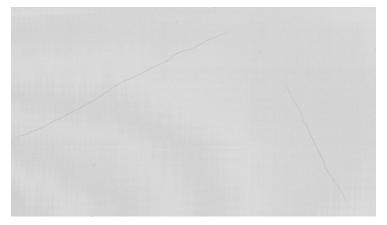
Abb.: https://de.wikipedia.org/wiki/Akustische_Mikroskopie#/media/Datei:Funktionsprinzip_akustisches_Mikroskop.svg



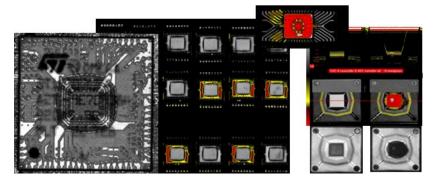


Applikationen aus Forschung und Industrie

Fehleranalyse - Qualitätsüberwachung - Qualifizierung - Prüfung - Technologieoptimierung



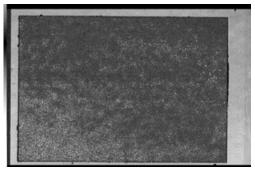
Rissanalyse SiC-Tafel



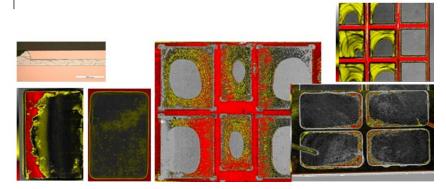
Prüfung von IC im Plastic Package, CSP und BGA auf Delaminationen, Gehäuserisse, Chipbrüche und Fehler der Chipkontaktierung



Kontaktierungsüberprüfung Chip-Keramik



Prüfung Materialinhomogenität



Prüfung von Powermodulen und DCB-Aufbauten auf Probleme der Heat-Sink-Kontaktierung, auf Muschelrisse in der Keramik und Delaminationen der Layer



Kontakt:

Luise Geppert / Leopold Panier

Technische Universität Dresden

Zentrum für mikrotechnische Produktion

Helmholtzstr. 10

D-01069 Dresden

Tel. +49 351 463 42924

E-Mail: <u>luise.geppert@tu-dresden.de</u> / <u>leopold.panier@tu-dresden.de</u>

www.zmp-dresden.de

www.nanoeva.de



